

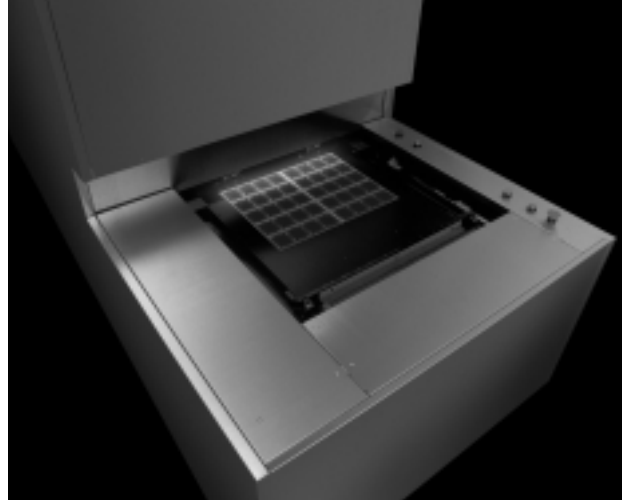
ダイレクトイメージング装置 Data Direct Imager DI-2080 Series

ペンタックスの提唱するダイレクト・イメージング
Direct Imaging Solution which
PENTAX advocates

【概要】

「DI-2080」は、CSP/FC-BGAに代表されるモジュール基板や、ファイン化の進む電子部品用のダイレクトイメージング装置であり、業界初の最小ライン/スペース15 μ mの描画を実現しました。

『DI-2080』 is the first Direct Imaging System in the PCB manufacturing, that has realized 15 micron Line and Space for the substrate such as CSP/FC-BGA and electronic parts requiring for finer patterns.



【特徴】

- ・独自の面描画方式、 μ MIテクノロジー^(※1)
- ・最小ライン/スペース15 μ m
- ・所望のタクト・タイムを実現できる、モデル構成
- ・ランニングコストを削減できる、長寿命光源紫色レーザー・ダイオードを採用
- ・基材の伸縮による“合わせ問題”を解決するリアルタイムスケールリング(RTS)機能
- ・基材単位にロットナンバーなどを描画できるナンバリング機能
- ・フレキシブル製造を可能とする自動化ラインが構築可能
- ・ソルダーレジストへもダイレクト描画

※1： μ MIテクノロジー(μ (Micro)-Mirror Imaging Technology)とは、従来のレーザー・スキャニング方式のドット(点)による描画方式に替え、二次元表示素子を用いた面による描画を実現したペンタックス独自の光学技術です。

Features

- ・ Imaging by unique 2 dimensional methodology ; uMIT^(*)
- ・ Minimum Line/Space ; 15 micron
- ・ Several models depending on the required Throughput
- ・ Running cost reduction by Violet Laser Diode as longer life light source
- ・ RTS^(**) to solve “registration problems” caused by expansion and contraction of panel
- ・ Auto Numbering function to put the specified characters on each panel
- ・ Flexible manufacturing line integrated with Automated Material Handling System
- ・ Direct imaging on the Solder Resist

*1 uMIT (Micro Mirror Imaging technology) is the original optical technology by PENTAX, direct-imaging by using 2 dimensional mirror device instead of conventional Laser Scanning.

**2 Real Time Scaling

PENTAX
ペンタックス株式会社
ビジネスシステム事業部

営業部
〒174-8639 東京都板橋区前野町2丁目36番9号
TEL : 03-3690-5152
<http://www.pentax.co.jp/>

ダイレクトイメージング装置 Data Direct Imager DI- μ Series

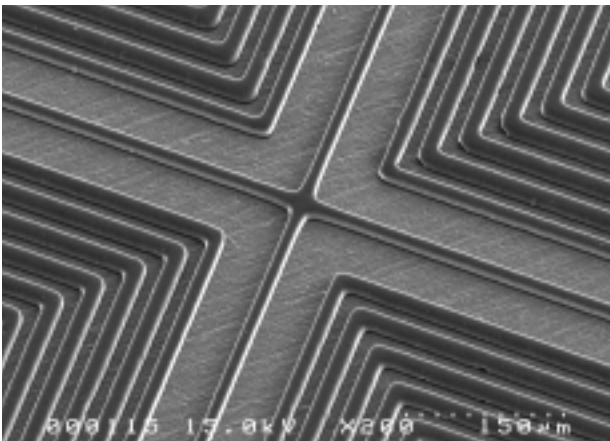
【概要】

「DI- μ シリーズ」は小型のダイレクトイメージング装置であり、最小ライン/スペース15 μ mのパターンをダイレクト描画でき、更に10 μ mの実現を目指しております。

ツール・レスを実現することで、ますますファイン化が要求されるCSP/FC-BGAに代表されるモジュール基板、フレキシブル基板等の開発・試作が短期間で行えます。また、基材/感光材料の開発やフラット・パネル分野の新工法開発・試作用途にも最適です。

『DI-u Series』 is a compact Direct Imaging System that has realized 15 micron Line and Space, whose final target is 10 micron.

Tool-less exposure process provides the shorter delivery/R&D time for the substrate such as CSP/FC-BGA and electronic parts requiring for finer patterns. In addition, this system is very suitable machine for the R&D of materials and photo sensitive resist, etc., also R&D of the new process for Flat Panel display and so on...



ペンタックスの提唱するダイレクト・イメージング
Direct Imaging Solution which
PENTAX advocates

【特徴】

- 独自の面描画方式、 μ MIテクノロジー^(※1)
- 最小ライン/スペース15 μ m
- 描画エリア230x300mm
- 所望のタクト・タイムを実現できる、モデル構成
- 任意の露光量を設定可能
- ランニングコストを削減できる、長寿命光源紫色レーザー・ダイオードを採用
- リアルタイムスケールリング (RTS) 機能^(※2) : オプション

※1: μ MIテクノロジー (μ (Micro) -Mirror Imaging Technology) とは、従来のレーザー・スキャニング方式のドット (点) による描画方式に替え、二次元表示素子を用いた面による描画を実現したペンタックス独自の光学技術です。

※2: CCD自動アライメントによる、自動スケールリング機能

Features

- Imaging by unique 2 dimensional methodology ; uMIT^(*)
- Minimum Line/Space ; 15 micron
- Imaging area ; 230 x 300 mm
- Several models depending on the required Throughput
- Easy to control exposure energy
- Running cost reduction by Violet Laser Diode as longer life light source
- Real Time Scaling^(*) : Option

*1 uMIT (Micro Mirror Imaging technology) is the original optical technology by PENTAX, direct-imaging by using 2 dimensional mirror device instead of conventional Laser Scanning.

*2 Real Time Scaling by CCD automatic alignment

PENTAX
ペンタックス株式会社
ビジネスシステム事業部

営業部
〒174-8639 東京都板橋区前野町2丁目36番9号
TEL : 03-3690-5152
<http://www.pentax.co.jp/>